3

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-258329

(43) Date of publication of application: 18.11.1991

(51)Int.CI.

B01D 65/00

B010 65/02

(21)Application number: 02-056873

(71)Applicant: YUASA CORP

(22)Date of filing:

07.03.1990 (7)

(72)Inventor: TAKEUCHI KAZUSUMI

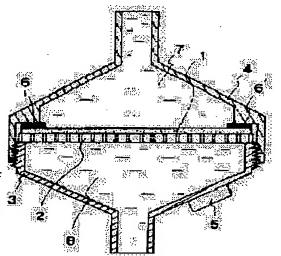
TANSHU SHIRO

(54) FILTER UNIT

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a required flow rate of filtration without deteriorating the quality of filtrate by soaking both the fed liq. side and, the filtrate side of a filter membrane in water before the beginning of filtration and applying ultrasonic waves.

CONSTITUTION: When water—based fed liq. is filtered with a membrane of a hydrophobic microporous polymer such as PE, both the fed liq. side and the filtrate side of the filter membrane 1 are soaked in water before the beginning of filtration and ultrasonic waves are applied with an ultrasonic oscillator 5. A required flow rate of filtration can be obtd. without deteriorating the quality of filtrate.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

· ⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫公開特許公報(A) 平3-258329

®Int. CI. 5

識別記号

庁内整理番号

网公開 平成3年(1991)11月18日

B 01 D 65/00

65/02

8014-4D 8014-4D 5 1 0

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

60発明の名称

口過装置

②特 願 平2-56873

顧 平2(1990)3月7日 @出

武 個発 B) } 者 内 鉢

大阪府高槻市城西町 6番 6号 湯浅電池株式会社内

@発 明

宗 丹

榖 朗 湯洼電池株式会社 の出

大阪府高槻市城西町6番6号

1. 発明の名称

口 過 夢

2. 特許請求の範囲

酸水性の番孔高分子材料を用い、水を主成分 とする供給液を口通するにおいて、口過應益前 に口過度の供給液倒と口液偏の再面を水に浸し、 避音波を作用させることを特徴とするロ過铵量。

5. 発明の詳細な説明

重乗上の利用分野

本発明は、水を主成分とする供給液の口過費 世に関するものである。

従来技術とその問盤点

水あるいは水溶液などの口過には、要求され るロ過筒皮に応じて、精密ロ過酸量や展外ロ過 笠屋などが用いられるが、ロ材として疎水性の 敬孔高分子材料で作ったロ温度を使用した場合、 透水性が悪く口液の液量があまり多く取れない という問題があった。このような政水性高分子 材料としては例えば、エチレンのふっ化物や塩

化物を重合体の散孔膜などがあり、対象品性な ど他の腰特性は優れたものが多く含まれている。

これに対し、例えばポリピニルアルコールな ど親水性の材料を用いて作ったロ過度もあるが、 現状では複倣的強度や展形状の安定性、耐久性、 信頼性、コストなど他の特性に問題があり、ま だ金ての面で演足できるものは得られていない のが事情である。

疎水性の口過度の透水性を改善するため、口 過度製造時に界面活性材を含要させて乾燥後に 出荷する方法が取られる場合もある。これによ って透水性はかなり改善されるが、このような ロ過度は製造工程が気能になるばかりではなく ロ過を始めるとロ液に界面活性材が溶出して混 入し水質が悪くなる欠点があった。

森以の月的

本発明は上記従来の問題点に重みなされたも のであり、ロ液の水質を悪化させることなく必 基かり過途量を得ることができる優れたり過費 量を提供することを目的とするものである。

発明の構成

本発明のロ選芸優の使用方法はロ選を開始する前に疎水性のロ過度の散孔内の空気を超音波の作用を利用することによって水と優美させ、透水性を向上させるものである。すなわちロ過度の両面が水につかった状態で超音波を水に伝数させると水は激しく振動し、散孔内にも飛び込む。この時に空気が最孔から押し出され気をとなって排除され、比較的短時間で最孔内は水で優美される。

従って、疎水性のロ遊膜を使用しながら透水性を大幅に改善することができる。 作用

政水性のロ過度で透水性が劣るのは、主としてロ過度の扱孔の中に空気が溶り、この散孔の内壁が水をはじくため漏れ軽く、微孔の中に水が浸入し軽いことによる。しかし、通常一度無孔内の空気を水で置換するとその後はロ過度を乾燥しない殴り透水性は良好に維持される。 事施例

無論これらとは別に水質の良好な水を中過铵度 に注入してもよい。

このように本発明のロ過酸量の使用方法によればロ過度1を界面活性剤などの水質に最影響を及ぼす組品で処理する必要がないので、良好な水質の中液が得られる。 、

以下、木寿集について一実施例により説明す

第1 図は本発明のロ過装置の一実施例を示した要部の戦断面図である。

1はポリエチレン系合成樹脂製の特害ロ浸膜で平均孔径2mm の多数の散孔が空いている。 2は直径3 mmの穴が多数空けられたステンレス合金製の口過度支持板、3はステンレス合金製の口過度支持板、3はステンレス合金製の口過容器で、4はステンレス合金製の口過容器3の蓋、5は口過容器3の底部に取り付けられた超音波接動子、6及び6'はゴムパッキング、7は口過度1の供給液偶の水、8は口過頭1の口液偶の水である。

なお、供給液倒の水7と口液倒の水8は口透 庚1を取り付け後熱温で数酯を行う場合はその 時の熱温をそのまま利用すればよく、また供給 液の水質によってはこれを供給液倒の水7とし て用いることもできる。さらに、本格的な口透 関始に先だって少量の口適を行いその時得られ た口液を口液側の水8に使用することもできる。

さらに、超音波振動子5はロ過中に働かせ、 ロ過度1に目動まり物質が付着するのを予防す るのにも使える。さらに逆洗浄中に目動まり物 質をロ過度1から分離させるのを補助するに用 いることもできる。

なお、第1図の実施例は平原によるロ過数度 を用いた場合を示したが、本発明は他にも中空 糸によるモジュールやデリーツ構造のカートリ ッジフィルターなどを用いるロ過数優にも適用 できるのはいうまでもない。

第1回の実施例の場合、超音波を作用させる 前鉄でロ過度1の透水速度を実刻して比較した 結果、超音旋作用後の方が約3倍速度が大きい ことが利明した。

発明の効果・

上述した知く、本発明は可限の水質を悪化させることなく必要な可過液量を得ることができる優れた可過装置を提供することが出来るので、 その工業的価値は個めて大である。

・なお、このようなロ過は電子工業用の超純水

特閒平3-258329(3)

や医薬品用の無菌水などを得るために用いられるが、他にも食品加工の際の口過などにも用いることができる。また、 限外口過装置などを使う場合にも用いることが可能である。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の口過装置の一実施例を示した要部の縦断面図である。

1 …精密口透膜

2 … 口過膜支持板

3 --- 口過容器

4 … 激

5 … 超音波摄動子

6. 6' … ゴムパッキング

7 … 供給液倒の水

8 … ロ過液倒の水

出窑人 溢淺電池株式会社

第 1 図

